

別紙添付の書類は下記の出願書類の勝本に相違ないことを証明する。 This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Pate of Application:

1980年9月30日

.. 願 番 号 Application Number:

昭和55年特許願第136449号

顧 人 ②licant (s):

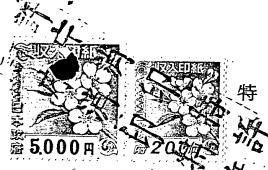
三 共 株 式 会 社

198 月 3

特許庁長官 Director-General, Patent Office 島 田 春



G. Wash



C07D501/34 A61K31/545

許 願 「特許法第38条ただし書」 の規定による特許出願 」(1) ど

昭和55年9月30日

(5,400 国)

特許庁長官`島田春樹殿



1. 発明の名称

グイコウヨウンシ 経口用セフアロスポリン化合物

- 2. 特許請求の範囲に記載された発明の数
- 5

3. 発 明 者

居所 東京都品州登広町 手背 2 藩 5 8 芎 世 章 2 韓 5 8 芎 章 英株式会社中央研究所对

氏 名

节 產 疑 雄

(外4名)

4. 特許出願人

住所 〒103 東京都中央区日本橋本町3丁目1番地の6 名称 (185) 三 共 株 式 会 社 代表者 取締役社長 河 村 喜 典

5. 代 理 人

居所 〒140 東京都品川区広町1丁目2番58号

三共株式会社内

電話 492-3131

氏名

弁理士

(6007)

樫出庄

6. 添付書類の目録

- (1) 明細書
- .(2) 図 面
  - (3) 委任状
  - (4) 願書副本



1 通

なし

1 通

1 通







# 7. 前記以外の発明者、特許出願人または代理人

# (1) 発明者

氏名

居所 東京都岛加色宏矿 子門首 2 蕃 5 8 亨

が、サッチ

居所 同 所

居所 同 所

氏名 賀 原 真 任

居所 同 所

智是

明 細 書

- 1. 発明の名称 経口用セフアロスポリン化合物
- 2. 特許請求の範囲
  - (1) 一般式

$$\begin{array}{c|c} N & C - CONH & S \\ H_2N & S & N \\ OR_1 & COOY \end{array}$$

「式中, $R_1$ は水素原子または低級アルキル基, $R_2$ は低級アルキル基,Yはフタリジル基または式  $-CHOCOR_4$  基(式中, $R_3$ は水素原子または $R_3$ 

メチル基を、R<sub>4</sub>は低級アルキル基または低級アルコキシ基を表わす。)〕で示されるセフアロスポリン化合物(シン異性体)およびその薬学的に許容し得る塩。

### (2) 一般式



「式中,R<sub>2</sub>は低級アルキル基,Yはフタリジル基または式-CHOCOR<sub>4</sub>基(式中,R<sub>3</sub>は水素

原子またはメチル基を, R4は低級アルキル基または低級アルコキシ基を表わす。) 〕で示される化合物を,一般式

(式中,R<sub>5</sub>はアミノ基または保護されたアミノ基を,R<sub>6</sub>は水酸基,保護された水酸基または低級アルコキシ基を表わす。)で示されるカルボン酸またはその反応性誘導体と反応させ,一般式

(式中, $R_2$ ,  $R_5$ ,  $R_6$ および Y は前述したものと同意義を有する。)を有する化合物を製造し,  $R_5$ が保護されたアミノ基, $R_6$ が保護された水酸



基である場合にはその保護基を除去することを 特徴とする一般式

(式中,R<sub>1</sub>は水素原子または低級アルキル基を示し,R<sub>2</sub>およびYは前述したものと同意義を有する。)で示されるセフアロスポリン化合物(シン異性体)およびその薬学的に許容し得る塩の製造法。

#### (3) 一般式

(式中,R<sub>2</sub>は低級アルキル基,R<sub>5</sub>はアミノ基または保護されたアミノ基を,R<sub>6</sub>は水酸基,保護された水酸基または低級アルコキシ基を表わす。)で示されるカルボン酸化合物またはその反応性誘導体をフタリジルハライドまたは一般



式

(式中,R<sub>5</sub>は水素原子またはメチル基を,R<sub>4</sub>は低級アルキル基または低級アルコキシ基を表わす。)で示される化合物若しくはその反応性誘導体と反応させ,一般式

(式中,Yはフタリジル基または 式-CHOCOR<sub>4</sub>基(式中,R<sub>3</sub>およびR<sub>4</sub>は前述した R<sub>3</sub>

ものと同意義を有する。)を示し、R<sub>2</sub>、R<sub>5</sub>およびR<sub>6</sub>は前述したものと同意義を有する。〕を有する化合物を製造し、R<sub>5</sub>が保護されたアミノ基、R<sub>6</sub>が保護された水酸基である場合にはその保護基を除去することを特徴とする一般式



(式中,R<sub>1</sub>は水素原子または低級アルキル基を示し,R<sub>2</sub>およびYは前述したものと同意義を有する。)で示されるセフアロスポリン化合物(シン異性体)およびその薬学的に許容し得る塩の製造法。

#### (4) 一般式

「式中,R<sub>2</sub>は低級アルキル基,Yはフタリジル基または式-CHOCOR<sub>4</sub> (式中,R<sub>3</sub>は水素原子 R<sub>3</sub>

またはメチル基を、R<sub>4</sub>は低級アルキル基または低級アルコキシ基を、Xはハロゲン原子を表わす。」で示される化合物をニトロソ化して、一般式



(式中,R<sub>2</sub>, Yおよび X は前述したものと同意義を有する。)で示されるヒドロキシイミノ化合物に変換し,次いでこれをチオ尿素と反応させることを特徴とする一般式

(式中,R<sub>2</sub>および Y は前述したものと同意義を有する。)で示されるセフアロスポリン化合物 (シン異性体) およびその薬学的に許容し得る塩の製造法。

### (5) 一般式



「式中,R<sub>1</sub>は水素原子または低級アルキル基,R<sub>2</sub>は低級アルキル基,Yはフタリジル基または式-CHOCOR<sub>4</sub>基(式中,R<sub>3</sub>は水素原子またはメーR<sub>3</sub>

チル基を,R4は低級アルキル基または低級アルコキシ基を表わす。) ]で示されるセフアロスポリン化合物(シン異性体) およびその薬学的許容し得る塩を有効成分として含有する経口投与用細菌感染症治療剤。

### 3. 発明の詳細な説明

本発明は経口投与用セフアロスポリン化合物 に関する。更に詳しくは,本発明は一般式(I)

$$\begin{array}{c|c}
 & N & C & -CONH & S \\
 & & & CH_2OR_2
\end{array}$$
OR 1 COOY

「式中、R<sub>1</sub>は水素原子または低級アルキル基、R<sub>2</sub>は低級アルキル基、Yはフタリジル基または式-CHOCOR<sub>4</sub>基(式中、R<sub>3</sub>は水素原子またはメーR<sub>3</sub>



チル基を、R4は低級アルキル基または低級アルコキシ基を表わす)〕で示されるセファロスポリン化合物(シン異性体)およびその薬学的に許容し得る塩、その製造法並びにその化合物を有効成分として含有する経口投与用細菌感染治療剤に関する。

前記一般式(I) において好適には,R<sub>1</sub>は水素原子または例えばメチル,エチル,ロープロピル,イソプロピル,ローブチル,イソブチル, sec ーブチル,tertーブチルのような炭素数 1 乃至 4 個を有する直鎖状若しくは分枝鎖状のアルキル基を示し,R<sub>2</sub>は例えばメチル,エチル,ロープチル,イソプロピル,ローブチル,イソプロピル,ローブチルのような炭素数 1 乃至 4 個を有する直鎖状若しくは分枝鎖状のアルキル基を示し,Yはフタリジル基または、CHOCOR<sub>4</sub> 基(式中,R<sub>3</sub>は水素原子または R<sub>3</sub>

メチル基を, R<sub>4</sub>は例えばメチル,エチル,nー プロピル,イソプロピル,nーブチル,イソブ



チル、Becーブチル、tertーブチルのような炭素数1乃至4個を有する直鎖状若しくは分枝鎖状のアルキル基または例えばメトキシ、エーブト・カープロポキシ、イソプロポキシ、ローブトキシのような炭素数1乃至4個を有する直鎖状若しくは分枝鎖状のアルコキシ基を表わす。)を示す。

本発明に係る前記一般式(I)を有する化合物は 新規化合物であり,消化管からの吸収がよく, 且つ生体内で速かに4位のエステルがが分解 してカルボン酸型になるため,カルボン酸型になるため。 の高い血中濃度を得ることがあるといかであるといかであるとのであるとのがあるという。 とは歯等の感染症の治療に対してある。カルボン酸型化合物を有するが質である。 な効果を有するが現な化合物であり、その抗菌 活性後述するように極めてすぐれた有する。

ペニシリン系,セフアロスポリン系抗生物質 には,多くの優れた効果を有する化合物がみら



れるが,消化管からの吸収のよいものは極めて 少なく、そのために実用化されないまゝ開発を 断念された化合物も少くない。殊にセフアロス ポリン系抗生物質においてはセフアレキシンあ るいはその類似体のように限られた構造を有す る化合物のみが実用に供されているにすぎない。 例えば注射用セフアロスポリン剤として汎用さ れているセファロチン,セファゾリン,セフメ タゾール等を経口投与した場合の尿中回収率は いづれも投与量の5%前後で,消化管からの吸 収は極めて悪いことが知られている。その理由 はセフアロスポリンの 4 位のカルボキシル基の 解離度が大きく(pKa値が小さく)酸性が強い ためである。

そこでペニシリンの3位およびセフアロスポリンの4位のカルボキシル基をエステル化することによつて、消化管からの吸収を改善しようとする試みがなされており、ペニシリン系化合物については一、二実用化されているものがあるが、セフアロスポリン系化合物についてはみ



られない。

例えばセフアマンドールのアセトキシメチル エステルに関してザ・ジャーナル・オブ・アン チバイオチツクス,32巻,11号,1155頁 (1979年) に報告されているが、それによる と、エステル化によつて水に難溶性になるため 吸収は改善されない、従つてプロピレングリコ ールのような有機溶媒の溶液として投与するこ とによつてのみ吸収がある程度改善されること が記述されている。また一方、水に溶けやすい エステルとしてジャーナル・オブ・メディシナ ルケミストリー,22巻,657頁(1979年) に研究結果が報告されているが,この場合は化 学的に不安定なため,吸収はよくならなかつた と記述されている。

本発明者は,長年に亘つてセファロスポリン化合物の化学的修飾による消化管からの吸収の改善,経口投与による血中濃度の増大について研究を重ねたが,それらの性質は,化合物の薄造全体に関連し,構造の一部分に変化があれば



同じような化学的修飾例えばエステル化を行なっても、その消化管からの吸収は全く予測し得ないことを知つた。本発明は、そのような研究の結果なされたものである。

即ち、本発明の化合物と一見構造が類似している下記公知化合物のピバロイルオキシメチルエステルを合成し、経口投与による尿中回収率を試験したところ、必ずしも良い結果は得られず、この系統の化合物に関しては3位の置換基が極めて重要な役割を果していることを見出した。

化合物 1 R<sub>1</sub>= H A = 
$$CH_2S \stackrel{N-N}{\searrow}_{S} CH_3$$

" 2 R<sub>1</sub>=  $CH_3$  A =  $CH_2OCOCH_3$ 

" 3 R<sub>1</sub>=  $CH_3$  A =  $CH_2S \stackrel{N-N}{\searrow}_{S}$ 

CH<sub>3</sub>

本発明に係る前記式(I)を有する化合物は,以下に述べる方法, すなわち

- (a) エステル化された 7 ーアミノー 3 ーアルコ キシメチルセフアロスポリン(II) のアシル化法
- (b) 化合物(I) に対応するカルボン酸 (I),またはそのアミノ基および水酸基が保護された化合物(V) のエステル化法および脱保護化法あるいは
- (c) 7位のアシル基を他のアシル基から化学反応によつて所望のアシル基に誘導する方法 によつて製造することができる。

上記の方法は具体的には次のように実施される。

(a) は一般式

【式中,R2は低級アルキル基,Yはフタリジル基または式-CHOCOR4 (式中,R3は水素原子R3



またはメチル基を, R<sub>4</sub>は低級アルキル基または低級アルコキシ基を表わす) ]で示される化合物を,一般式

(式中,R5はアミノ基または保護されたアミノ基を,R6は水酸基,保護された水酸基または低級アルコキシ基を表わす)で示されるカルボン酸またはその反応性誘導体と反応させ,一般式

(式中, $R_2$ ,  $R_5$ ,  $R_6$ および Y は前述したものと同意義を有する。)を有する化合物を製造し,  $R_5$ が保護されたアミノ基, $R_6$ が保護された水酸基である場合にはその保護基を除去することによつて目的化合物(I)が製造される。

上記式中, R<sub>5</sub>が保護されたアミノ基である場



合のアミノ基の保護基としては、容易に除去されてアミノ基に復元されるものが好ましく。それ自体公知の保護基例えば酸処理で除去しかが、カリチル基、ホルミル基、セーブトキシカルボニルー・ロルボールを表しうる 2、2 ートリクロルエトキシカルボニルを、アルカリ処理で除去できる 2 ーメチルスルホニルエチルカルボニル基、チオ尿素処理で除去しうるクロルアセチル基などが使用される。

また、Roが保護された水酸基である場合の水酸基の保護基としては、容易に除去されて水酸基に復元されるものが好ましく、それ自体公知の保護基例えば酸処理で除去しうるトリチル基、ジクロルアセチル基などが使用される。

本方法はアシル化工程と必要な場合には脱保 護工程との2工程よりなる。

アシル化工程において式皿を有する化合物は 遊離のまゝ或いはその反応性誘導体として使用 されるが,遊離のまゝ使用する場合には適当な





縮合剤を用いる。縮合剤としてはジシクロヘキ シルカルボジイミドのようなジ置換カルボジイ ミド,カルボニルジイミダゾール,チオニルジ イミダゾールのようなイミダゾライド,N-エ トキシカルボニルー2ーエトキシー1,2ージヒ ドロキノリン或いはジメチルホルムアミドとオ キシ塩化リン,塩化チオニルなどから調整され るビルマイヤー試薬などがあげられる。式皿を 有する化合物の反応性誘導体としては、酸ハラ イド,酸無水物,混合酸無水物,活性エステル, 活性アミド,酸アジド等があげられる。混合酸 無水物としては炭酸モノメチルエステルや炭酸 モノイソブチルエステルなどの炭酸モノ低級ア ルキルエステルとの混合無水物や,ピバリン酸 やトリクロル酢酸などの低級アルカン酸との混 合酸無水物が使用され、活性エステルとしては p -ニトロフエニルエステル,ペンタクロルフ エニルエステル, N-ヒドロキシラタルイミド エステルなどがあげられる。

本工程は通常溶媒中で行なうのが好ましく、

使用される溶媒は本反応に悪影響を与えないも のであれば限定なく、例えばアセトン、メチル エチルケトン,テトラヒドロフラン,ジオキサ ン,酢酸エチル,クロロホルム,ジクロルメタ ン,アセトニトリル,ジメチルホルムアミド。 ジメチルスルホキシドなどの不活性有機溶媒或 いは水との混合溶媒などが使用される。使用さ れる反応性誘導体の種類によつては必要に応じ 塩基を存在させることがある。塩基の例として はアルカリ金属化合物例えば重炭酸ナトリウム。 重炭酸カリウム,炭酸ナトリウム,炭酸カリウ ムなど,脂肪族,芳香族,含窒素複素環塩基例 えばトリエチルアミン,ジメチルアニリン, N ーメチルピペリジン , N ーメチルピロリジン , ピリジン,コリジン,ルチジンがあげられる。 反応温度に特に限定はないが通常反応は室温又 は冷却下で行なわれる。反応に要する時間は主 としてアシル化方法の種類,反応温度等によつ でも異なるが通常数十分乃至数十時間である。 反応終了後,式Mを有する化合物は常法によつ



て反応混合物から採取される。例えば反応溶媒が水混和性の場合には一旦減圧で留去した後水不混和性溶媒に代え,溶媒が水不混和性の場合はそのまゝ酸および塩基で洗い,乾燥した後溶媒を留去することによつて得られる。必要に応じ常法例えば各種クロマトグラフィー等によつて精製することもできる。

脱保護工程は先に述べたように,各保護基の 特性に基いて常法によつてそれらの保護基を除 去し,粗生成物を精製して式(I)を有する目的化 合物を得ることができる。

また,(b)は一般式

$$\begin{array}{c|c}
N & C & CONH & S \\
R_5 & S & N & CH_2OR_2
\end{array}$$
(V)

(式中,R<sub>2</sub>,R<sub>5</sub>およびR<sub>6</sub>は前述したものと同意義を有する)を有するカルボン酸化合物またはその反応性誘導体を,フタリジルハライドまたは一般式



HOCHOCOR<sub>4</sub> I R<sub>3</sub>

(V)

(式中,R<sub>5</sub>およびR<sub>4</sub>は前記と同意義を有する)を有する化合物若しくはその反応性誘導体と反応させ前記式(M)を有する化合物を得て,更にR<sub>5</sub>およびR<sub>6</sub>が保護された基である場合には(a)法と同様にして脱保護することによつて目的化合物(I)が製造される。

本反応において、両出発物質は一方または両方またはです。 方を縮合に有利な反応性誘導体としてボンウのといっては、例を有するは、例のなばナトリクのなが、リウンスがある。 のアウムのなが、できるでは、一般では、アンカのなが、できるでは、のからなが、できるでは、のからなが、でいるでは、のからなが、でいるでは、のでは、アンガーのでは、アンカーのでは



ートルエンスルホニルエステルのようなスルホ ニルエステル,ヒドロキシル基を塩素,臭素ま たは沃素で置換したハロゲン置換化合物等があ げられる。反応は適当な溶媒中で行なうのが好 ましく,そのような溶媒としては本反応に悪影 響をおよぼさないもの例えばジメチルホルムア ミド,ジメチルアセトアミド,ジメチルスルホ キシド,ヘキサメチルトリアミドホスフェート, アセトニトリル等或いは他の不活性有機溶媒と の混合溶媒があげられる。反応は通常室温また は冷却下に行なうのが好ましい。反応に要する 時間は通常数分乃至数時間である。反応終了後, 反応混合物を水不混和性溶媒で稀釈し、重硫酸 カリウム水溶液および塩基水溶液で洗い、乾燥 後溶媒を留去することによつて本反応の目的化 合物を得ることができる。このものは更に常法 例えば各種クロマトグラフィーにより精製する ことができる。アミノ基および水酸基が保護さ ·れている場合には,前記式(M)を有する化合物の 脱保護と同様にしてアミノ基および水酸基に変



換される。

また,(c)は一般式

(式中, Xは塩素, 臭素のようなハロゲン原子を示し, R<sub>2</sub>および Yは前記と同意義を有する。)で表わされる化合物をニトロソ化して, 一般式

(式中, X, R<sub>2</sub>および Y は前記と同意義を有する。)を有するヒドロキシイミノ化合物に変換し,次いでこれをチオ尿素と反応させることによつても前記式(I)を有する化合物(但し R<sub>1</sub>が水素原子を表わす。)を製造することができる。

本方法はニトロソ化工程とチアゾール環形成工程との2工程からなる。

ニトロソ化工程は,通常のβ-ジケトンのニ トロソ化と同じように行なわれる。即ち酸性の



チアゾール環の形成工程は、αーハロケト化合物とチオ尿素とによる環形成反応であり、適当な溶媒中で両者を接触させることによつて遂行される。使用される溶媒は本反応に悪影響を与えないものであれば限定はないが、ジメテルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、アセトニトリル等の溶解性の高いものが好ましい。 戸



以上の製造法によつて得られる前記式(I)を有する本発明の化合物は,前記の如く消化管からの吸収がよく,カルボン酸型化合物の高い血中濃度を与えるので経口投与が可能であり,製薬的常法によつて例えばデンプン,乳糖,白糖,炭酸カルシウム,リン酸カルシウム,ポリエチレングリコール等の賦形剤,例えばアラビアゴ

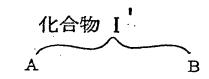


ム,カルボキシメチルセルロース,ヒドロキシプロピルセルロース等の結合剤,例えばステアリン酸マグネシウム,タルク等の滑沢剤,例えばカルボキシメチルカルシウム等の崩壊剤などと混合してカプセル剤,粉剤,顆粒剤,錠剤等経口投与剤を製造することができる。その投与量は,年令,体重,症状等によつても異なるが,成人に対し1日約0.2万至59,好ましくは0.5万至39であり,3万至4回に分けて与えることができる。

また,前記式(I)を有する化合物を使用するに当つて,遊離の型のみでなく薬学的に許容しうる酸付加塩例えば,塩酸,硫酸,硝酸のような無機酸,メタンスルホン酸,ベンゼンスルホン酸,マロン酸などのような有機酸の酸付加塩としても使用される。

本発明の化合物を経口投与すると,前述の如く,腸管より容易に吸収され,生体内で加水分解されて対応するカルボン酸 (I')

(式中,R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>は前記と同意義を示す。)またはその塩になる。化合物 (I<sup>1</sup>)のグラム陽性菌および陰性菌に対する抗菌活性 (最小発育阻止濃度, μ9/ml) は下記の如く極めて顕著なものである。



 $R_1 = H_3$   $R_2 = CH_3$   $R_1 = R_2 = CH_3$ 

スタヒロコツカス・アウレ

0.1

0.4

ウス 209P

エシエリヒア・コリNIHJ

0.4

0.4

シゲラ・フレキシネリ

0.8

0.8

クレプシエラ・ニューモニエ

0.2

0.1

プロテウス・ブルガリス

0.2

0.01

サルモネラ・エンテリチジス

0.4

0.2



また本発明の化合物および前述の類縁化合物 (化合物1,2および3)をマウスに経口投与 した時の尿中回収率(対応するカルボン酸の量) は夫々次の通りである。

#### 尿中回収率(%)

実施例1の化合物 40以上

実施例2の化合物 50以上

化合物 1 1 5

化合物 2 8

化合物 3 1 4

上記のように本発明はセフアロスポリンの3 位の置換基をアルコキシメチル基にすることに よつて消化管吸収が極めて良くなる点に特長が ある。

次に参考例および実施例をあげて前記式(I)を有する本発明の化合物の製造方法を具体的に説明するが、本発明はこれによつて限定されるものではない。なお、本発明の化合物のオキシム部分の異性体はすべてシン型である。



# 参考例 1.

7 ー [ 2 ー ( 2 ー クロルアセトアミドチアゾールー4 ー イル) ー 2 ー メトキシイミノアセトアミド] ー 3 ー メトキシメチルー 3 ー セフエムー 4 ーカルボン酸ジフェニルメチルエステルの製造法

- (A) ジメチルホルムアミド 0.0 5 7 元 に , 氷冷攪拌しながらオキシ塩化リン 0.0 6 1 元 を加え,4 0 ℃に加温して 1 時間攪拌後,乾燥した塩化メチレンを用い 2 回共沸する。これに酢酸エチル 1 元 を加え,室温ではげしく攪拌しながら 2 ー (2 ークロルアセトアミドチアゾールー4 ーイル) ー 2 ーメトキシイミノ酢酸200 写を加え 3 0 分間反応する。
- (B) 一方,7ーアミノー3ーメトキシメチルー

製造

3 ーセフエムー4 ーカルボン酸ジフエニルメチルエステル 200 mをジエチルアニリン 145 m と共に,乾燥した塩化メチレン 5 m に溶解し,一5℃に冷却して攪拌する。

この混合液(B) に前述の反応液(A) を滴下して 15 分間攪拌後, 反応液を減圧濃縮する。

残渣を酢酸エチル20㎡および水5㎡を用いて分液する。酢酸エチル層を分離し、さらに順次、飽和重炭酸ナトリウム水5㎡、5%塩酸水5㎡、飽和食塩水5㎡で洗浄し、無水硫酸マグネシウムを加えて脱水乾燥する。乾燥剤を沪去して沪液を減圧濃縮し、得られた残渣をシリカゲル(Kieselgelー60)30%、溶媒系ローペキサン一酢酸エチル(3:2)を用いてロマトグラフィー処理し、7ー〔2ー(2ークロルアセチルアミノチアゾールー4ーイル)ー2ーメトキシイミノアセトアミド〕ー3ーメトキシメチルー3ーセフエムー4ーガルボン酸ジフェニルメチルエステル213 吻を得た。

核磁気共鳴スペクトル (CDCL<sub>3</sub>) δ<sub>ppm</sub>



3.19 (3H,S,3位OCH<sub>z</sub>)

3.51 (2H,S,2位 CH<sub>2</sub>)

409 (3 H, S, OCH3)

4.20 (2H,S,3位 CH<sub>2</sub>)

4 2 2 (2 H , S , C&CH<sub>2</sub> ·CO )

5.02 (1 H, d, J=2.5 Hz, 6位)

5.86 (1 H, d.d, J=2.5, 4.5 Hz, 7位)

6.  $7 \sim 7$ . 6 (12 H, m)

### 参考例 2.

7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)ー2ーメトキシイミノアセトアミド]ー3ーメトキシメチルー3ーセフエムー4ーカルボン酸トリフルオロ酢酸塩の製造法

$$\begin{array}{c|c} N & \begin{array}{c} C & -CONH \\ \end{array} & \begin{array}{c} S \\ \end{array} & \begin{array}{c} CH_2OCH_3 \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2OCH_3 \\ \end{array} \end{array}$$

CF<sub>3</sub>COOH

7-[2-(2-クロルアセトアミドチアゾ



ールー4ーイル) ー2ーメトキシイミノアセト アミド〕-3-メトキシメチル-3-セフエム - 4 - カルボン酸ジフエニルメチルエステル 溶解し,チオ尿素45%を加えて溶解し,室温 で2時間反応する。反応液に飽和重炭酸ナトリ ウム水溶液を加え,酢酸エチル20㎡を用いて 抽出する。酢酸エチル層をよく水洗して過剰の チオ尿素を除去し,無水硫酸マグネシウム上で 脱水乾燥し、乾燥剤を沪去後、沪液を減圧濃縮 する。とうして得た残渣をシリカゲル(ワコー ゲル C - 100) 3 0 9上,酢酸エチルを用いて クロマトグラフイー処理し、7一〔2一(2一 アミノチアゾールー4ーイル) -2-メトキシ イミノアセトアミド]ー3ーメトキシメチルー 3 ーセフエムー4 ーカルボン酸ジフエニルメチ ルエステル 63 吻を得た。

これをアニソール 2 ml に溶解し、氷冷攪拌下 にトリフルオロ酢酸 1 ml を加え、室温にして 30 分処理する。反応液を減圧濃縮し、イソプロピ



ルエーテルを加えて生じた沈澱を戸取し,乾燥して,7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-メトキシイミノアセトアミド]-3-メトキシメチルー3-セフエムー4-カルボン酸トリフルオロ酢酸塩27吻を得た。 核磁気共鳴スペクトル(重アセトン中,重水添加)

δ ppm

3.29 (3 H , S , 3位-OCH<sub>3</sub>)

3.57 (2H,S,2位 CH<sub>2</sub>)

3.96 (3 H , S , OCH<sub>3</sub> )

4.27 (2H,S,3位 CH<sub>2</sub>)

5.15 (1 H, d, J = 2.5 Hz, 6位)

5.97 (1 H, d, J = 2.5 Hz, 7位)

6.59 (1 H, S)

#### 参考例 3.

7-フェノキシアセトアミドー3ーメトキシメチルー3ーセフェムー4ーカルボン酸ジフェニルメチルエステルの製造法

フェノキシアセトアミドー3-シメチルー3ーセフエムー4ーカルボン酸10.9 8 と重炭酸ナトリウム 2.25 8 を水 200 ml に溶解 し, Bacillus subtilis ATCC6633の凍結乾 燥菌体 1 0 9 を加え, pH7. 5 ~ 8 に調整して 40 ℃で1日攪拌する。菌体を沪去し、沪液を塩酸 で pH2 ~ 3 に調整し,酢酸エチル 200 mlで3回, 計 600 ㎡で抽出し、これを 5 0 ㎡の飽和食塩水 で洗浄後無水硫酸マグネシウムを加えて脱水乾 燥する。乾燥剤を沪去し、ジフェニルジアゾメ タン 6.3 9 を 加え , 2 時間 静 置 し , こ れ を 減 圧 濃縮する。残渣にエーテル 500 ㎡を加えて攪拌 し,生じた固体を沪取乾燥して,7-フェノキ シアセトアミドー3ーヒドロキシメチルー3-セフエムー4ーカルボン酸ジフエニルメチルエ ステル128を得た。



核磁気共鳴スペクトル (重DMSO中) δ ppm

3.65 (2H,S,2位 CH<sub>2</sub>)

429 (2H,d,J=3Hz,3位 CH<sub>2</sub>)

4.65 (2 H , S , CH<sub>2</sub>)

5.17 (1 H, t, J=3 Hz, 3位 OH)

5.19 (1 H, d, J=2.5 Hz, 6位)

5.76 (1 H, d·d, J=2.5, 4.5 Hz, 7位)

6.7~7.8 (16H,m)

9.11 (1 H, d, J = 4.5 Hz, NH)

7 ーフエノキシアセトアミドー3 ーヒドロキシメチルー3 ーセフエムー4ーカルボン酸ジフエニルメチルエステル5 を乾燥した塩化メチレン 400 ml に溶解し、3 弗化ホウ素エチルエーテル 0.1 ml を加えてー5 ~ 0 ℃に冷却し、過剰のジアゾメタン(約3 タ、Nーメチル-Nーニトロソーロートルエンスルホンアミド 21.4 gr から調整したエーテル溶液を加温して吹き込む)を作用させー日攪拌する。反応液を減圧濃縮し、シリカゲル 250 タ、溶媒系 n ーヘキサンー酢酸



エチル (3:2) を用いて精製し、7-フェノキシアセトアミドー3-メトキシメチルー3-セフエムー4-カルボン酸ジフェニルメチルエステル438を得た。

核磁気共鳴スペクトル (CDCL3) 8 ppm

3.20 (3H,S,3位 OCH<sub>3</sub>)

3.50 (2H,S,2位 CH<sub>2</sub>)

4.25 (2H,S,3位 CH<sub>2</sub>)

4.57 (2 H , S ,  $CH_2$ )

5.00 (1 H, d, J=2.5 Hz,6位)

5.87 (1 H, d·d, J=25, 45 Hz, 7位)

6.7  $\sim$  7.6 (17 H, m)

## 参考例 4.

7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)ー2ーヒドロキシイミノアセトアミド]ー3ーメトキシメチルー3ーセフエムー4ーカルボン酸トリフルオロ酢酸塩の製造法



ジケテン 16.8 弓を 2 配の塩化メチレンに溶解 し, - 3 0 ℃に冷却攪拌する。これに臭素 320 rogを塩化メチレン 2 ml に溶解して滴下する。 C の反応液を一5℃に冷却した7ーアミノー3ー メトキシメチルー3ーセフエムー4ーカルボン 酸ジフエニルメチルエステル 362 吻およびジエ チルアニリン 299 吻を含む塩化メチレン溶液 5 ml に 滴下し, 3 0 分間 反応する。 反応 液を減圧 濃縮し,酢酸エチル50㎡に溶解し各5㎡の水, 5 % 塩酸水,飽和食塩水で洗浄し,無水硫酸マ グネシウム上で脱水乾燥後,脱水剤を沪去して **沪液を減圧濃縮する。こうして得た残渣をシリ** カゲル309,溶媒系n-ヘキサン一酢酸エチ ル (1:1) を用いてクロマトグラフィー処理 し、ブロムアセチルアセトアミドー3ーメトキ



シメチルー3 ーセフエムー4 ーカルボン酸ジフ エニルメチルエステル 118 *吻*を得た。

これを酢酸 5 ml に溶解し、室温で攪拌しながら 亜硝酸ナトリウム 1 6 mgを少しずつ加え、30 分間攪拌する。これに酢酸エチル2 0 mlを加え、飽和食塩水で3 回洗浄後無水硫酸マグネシウムを用いて脱水乾燥し、乾燥剤を除去して減圧濃縮する。こうして得た残渣を10 gのシリカゲル上溶媒系ローへキサンー酢酸エチル(1:1)でクロマトグラフイー処理して、7ー(2ープロムアセチルー2ーヒドロキシイミノアセトアミド)ー3ーメトキシメチルー3ーセフエムー4ーカルボン酸ジフエニルメチルエステル76 mgを得た。

この化合物 7 6 m を , N , N ージメチルアセトアミド 3 m に溶解し , チオ尿素 1 9 m を加えて 2 時間攪拌する。反応液を酢酸エチル 2 0 m に加え , 飽和重炭酸ナトリウム水でよく洗浄して過剰のチオ尿素を除去し , 無水硫酸マグネシウム上で脱水乾燥し , 乾燥剤を除いて減圧濃縮



する。

こうして得た残渣を、シリカゲル5g、溶媒 酢酸エチルを用いてクロマトグラフイー処理し、 7ー[2ー(2ーアミノチアゾールー4ーイル) ー2ーヒドロキシイミノアセトアミド]ー3ー メトキシメチルー3ーセフエムー4ーカルボン 酸ジフエニルメチルエステル4gmgを得た。

この化合物 4 9 啊をアニソール 1 ㎡ に溶解しトリフルオロ酢酸 0.5 ㎡ を加えて室温で一時間静置し,反応液を減圧濃縮する。これをアセトン 1 ㎡ に溶解しイソプロピルエーテル 2 0 ㎡ を加えて生じた沈澱を沪取乾燥して,7- [2- (2-アミノチアゾールー4ーイル)ー2ーヒドロキシイミノアセトアミド ]ー3ーメトキシメチルー3ーセフエムー4ーカルボン酸トリフルオロ酢酸塩 2 8 啊を得た。

核磁気共鳴スペクトル (重メタノールーd) 8 ppm

3.28 (3 H , S , 3位 OCH<sub>3</sub>)

3.55 (2H,S,2位 CH<sub>2</sub>)

4.29 (2H,S,3位 CH<sub>2</sub>)



## 参考例 5.

7 ーフエノキシアセトアミドー3 ーメトキシメチルー3 ーセフエムー4 ーカルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルの製造法

7 ーフェノキシアセトアミドー3 ーメトキシメチルー3 ーセフェムー4 ーカルボン酸ナトリウム塩1 %をジメチルスルホキシド 5 0 ml に溶解し、ピバロイルオキシメチルブロミド 975 mgを加えて室温で1 5 分間攪拌後、酢酸エチル200 mlを加え、飽和重炭酸ナトリウム水溶液 50 mlで順次流利・飽和重硫酸カリウム水溶液 5 0 mlで順次流浄し、無水硫酸マグネシウムで脱水乾燥後、乾



燥剤を沪去して減圧濃縮する。

てうして得た残渣をシリカゲル 100 g,溶媒系ローヘキサンー酢酸エチル (1:1) を用いてクロマトグラフィー処理し,7ーフエノキシアセトアミドー3ーメトキシメチルー3ーセフエムー4ーカルボン酸ピバロイルオキシメチルエステル 750 mを得た。

核磁気共鳴スペクトル (CDCL<sub>3</sub>) 8<sub>ppm</sub>

1.25 (9 H, S)

3.35 (3H,S,3位 OCH<sub>3</sub>)

3.54 (2H,S,2位 CH<sub>2</sub>)

4.29 (2H,S,3位 CH<sub>2</sub>)

4.58 (2 H, S, CH<sub>2</sub>-O-Phe)

5.01 (1H,d,J=2.5Hz,6位)

5.6~6.1 (3H,m,7位およびCH<sub>2</sub>)

6.7~7.6 (6 H , m , PhonyはおびNH)

## 実施例 1.

7-[2-(2-アミノチアゾールー4ーイル) - 2-メトキシイミノアセトアミド] - 3



ーメトキシメチルー3 ーセフエムー4 ーカルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルの製造法

五塩化リン 488 吻を乾燥した塩化メチレン 5 **ルに溶解し、オキシ塩化リン 120 吻を加え**,室 温で攪拌しながらピリジン 247 gを加える。こ れを一10℃まで冷却し、7-フェノキシアセ トアミドー3ーメトキシメチルー3ーセフエム 4 -カルボン酸ピバロイルオキシメチルエス テル 769 吻を加え、徐々に室温にもどす。 2 時 間攪拌後再びOCに冷却し,nープロピルアル コール 1.5 配を加えて30分間攪拌する。さら に少量の水を加え15分攪拌し,酢酸エチル50 ml を加え飽和重炭酸ナトリウム水で洗浄する。 酢酸エチル層を無水硫酸マグネシウム上で乾燥 し、乾燥剤を沪去して減圧濃縮する。これにイ ソプロピルエーテルを加えてこすり,生じた沈



澱を沪取乾燥して,7-アミノー3-メトキシメチル-3-セフエム-4-カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステル 443 mを得た。

こうして得た 7 ーアミノー 3 ーメトキシメチ ルー3ーセフエムー4ーカルボン酸ピバロイル オキシメチルエステル 121 79 , ジエチルアニリ ン 141 g,およびジメチルホルムアミド71g. オキシ塩化リン 135 啊,2 - (2 - クロルアセ トアミドチアゾールー4ーイル) ー2ーメトキ シイミノ酢酸 265 gを用い参考例1の場合と同 様にアミド化し、反応液を分液抽出して目的物 を含む残渣を得,これをシリカゲル108溶媒 系酢酸エチルーnーヘキサン(2:1)を用い てクロマトグラフィー処理して,7月一〔2一 (2-クロルアセトアミドチアゾール-4-イ ル) -2-メトキシイミノアセトアミド]-3 ーメトキシメチルー3 ーセフエムー4 ーカルボ ン酸ピバロイルオキシメチルエステル 5 5 殴を 得た。

Chen, N-ij J Furthermore Furthermore



溶解し、チオ尿素 13.5 写を加え室温で 2 時間攪拌後酢酸エチル 2 0 ㎡を加えて、飽和重炭酸ウムでよく洗浄し、無水硫酸マグネ 融絡に 2 時間別力 では、乾燥 利を沪去して減圧 とった。 2 が 5 を が 5 を が 5 を が 7 で 1 と で 2 で 1 と で 2 で 2 で 3 で 4 で 1 と で 1 と 3 で 4 で 1 と 3 で 4 で 1 と 3 で 4 で 4 で 1 と 3 で 4 で 4 で 3 で 4 で 4 で 3 で 4 で 5 で 4 で 5 で 6 で 6 で 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で 1 3 6 写を 6 で 1 3 で

核磁気共鳴スペクトル (重アセトン中)  $\delta_{ppm}$ 

- 1.19 (9 H,S)
- 3.23 (3H,S,3位 OCH<sub>3</sub>)
- 3.52 (2H,S,2位 CH<sub>2</sub>)
- 3.90 (3 H , S , OCH<sub>3</sub>)
- 4.18 (2H,S,3位 CH<sub>2</sub>)
- 5.12 (1 H, d, J=2.5 Hz, 6位)
- 5.8~6.1 (3 H , m , 7位および CH<sub>2</sub>)
- 6.78 (1 H, S)



6.6  $\sim$  7.1 (2 H , bs , NH<sub>2</sub>) 8.01 (1 H , d , J = 4.5 H  $_{\rm Z}$  , N H)

## **寒施例 2.**

7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル) -2-ヒドロキシイミノアセトアミド]ー3-メトキシメチルー3-セフエムー4ーカルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルの製造法

ジケテン 168 mg , 臭素 320 mg , 7 ーアミノー 3 ーメトキシメチルー 3 ーセフエムー 4 ーカル ボン酸ピバロイルオキシメチルエステル 322 mg およびジエチルアニリン 299 mgを用い参考例 4 の場合と同様に反応処理して得た残渣をシリカゲル 3 0 タ溶媒系 n ーヘキサン 一酢酸エチル (1:1)を用いて精製し , 7 ーブロムアセチルアセトアミドー 3 ーメトキシメチルー 3 ーセフ



エムー4ーカルボン酸ピバロイルオキシメチル エステル 288 吻を得た。これを酢酸 5 ㎡ に溶解 し亜硝酸ナトリウム38%を用いて参考例4と 同様に反応,処理し、シリカゲル159、溶媒 系 n ーヘキサンー酢酸エチル (1:1)を用い て精製し,7-(2-プロモアセチルー2-ヒ ドロキシイミノアセトアミド) -3-メトキシ メチルー3 ーセフエムー4 ーカルボン酸ピバロ イルオキシメチルエステル 200 吻を得た。これ を N , N ージメチルアセトアミド 5 ml に溶解し チオ尿素 5 5 弓を用い参考例 4 と同様に処理し て後,シリカゲル108溶媒,酢酸エチルを用 いてクロマトグラフィー処理し,7-[2-( 2-アミノチアゾールー4-イル) -2-ヒド ロキシイミノアセトアミド] - 3 - メトキシメ チルー3 ーセフエムー4ーカルボン酸ピバロイ ルオキシメチルエステル 118 吸を得た。

核磁気共鳴スペクトル (重アセトン中)  $\delta_{ppm}$ 

1.21 (9H,S)

3.28 (3H,S,3位 OCH<sub>3</sub>)



4.27 (2H,S,3位 CH<sub>2</sub>)

5.21 (1 H, d, J = 2.5 Hz, 6位)

5.8~6.2 (3 H, m, 7位およびCH<sub>2</sub>)

6.87 (1H,S)

6.4  $\sim$  7.6 (3 H , m , NH<sub>2</sub> , OH)

9.0 (1 H, d, J = 4.5 Hz, NH)

#### 実施例 3.

7-[2-(2-クロルアセトアミドチアゾールー4-イル) -2-メトキシイミノアセトアミド]-3-メトキシメチルー3-セフエムー4-カルボン酸(シン異性体)19,ピバリン酸プロムメチルエステル380 PPおよび弗化カリ240 PPをジメチルスルホキシド「0 ml に加え、室温で1時間攪拌する。反応液に酢酸エチル100 mlを加え、水、5%重曹水、10%重硫酸

カリウム水溶液,飽和食塩水で順次洗浄し,硫酸マグネシウムで乾燥後,減圧で溶媒を留去する。残留物をシリカゲルを用いたカラムクロホルムー酢酸エチル(1:1]で精製すると,7ー[2ー(2ークロルアセトアミドチアゾールー4ーイル)ー2ーメトキシイミノアセトアミド]ー3ーメトキシメチルー3ーセフエムー4ーカルボン酸ピバロイルオキシメチルエステル300 啊が淡黄色粉末状で得られた。

上記化合物およびチオ尿素 6 0 m をジメチルアセトアミド 3 ml に溶かし、室温で 4 時間攪拌する。反応液を飽和重剪水 1 0 ml 中に注ぎ、酸エチルで抽出する。抽出液を 1 0 多重硫酸 カリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗つた後、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧で濃縮する。 グラフィー 〔溶媒、酢酸エチルーカーム (3 1 1 ) 〕で精製すると、7 ー 〔2 ー (2 ー アジールー4 ー イル) ー 2 ー メトキシイミ



ノアセトアミド ] ー 3 ーメトキシメチルー 3 ーセフエムー 4 ーカルボン酸ピバロイルオキシメチルエステル 200 mを得た。本品は実施例 1 の方法で得た化合物と同一であることを核磁気共鳴スペクトル、赤外線吸収スペクトルで確認した。

## 実施例 4.

実施例3の方法に従つて、ピバリン酸プロムメチルエステルの代りにイソ酪酸プロムメチルエステル360 Wを用いて反応させ、全く同様に処理することによつて、7-[2-(2-アミノチアゾールー4ーイル)ー2ーメトキシイミノアセトアミドコー3ーメトキシズチルー3ーセフエムー4ーカルボン酸 イソブチリルオキシメチルエステル 180 Wを微黄色粉末状に得る。



核磁気共鳴スペクトル (CDCℓ<sub>3</sub>) δ<sub>ppm</sub>:

1.20 (6 H, d, 
$$J = 6.5$$
)

2.66 (1 H, Septet, 
$$J = 6.5$$
)

3.21 (3H,S)

3.40 (2 H , ABq )

4.01 (3 H, S)

4.16 (2H,S)

5.05(1 H, d, J = 5)

5.6~6.2 (5 H, m)

6.65 (1 H, S)

8.06 (1 H, a, J=9)

## 実施例 5.

実施例3の方法に従つて、ピバリン酸ブロムメチルエステルの代りにプロピオン酸ブロムメチルエステル340 啊を用いて反応させ、全く同様に処理することによつて、7-[2-(2-



アミノチアゾールー4ーイル) ー2ーメトキシ イミノアセトアミドコー3ーメトキシメチルー 3ーセフエムー4ーカルボン酸 プロピオニル オキシメチルエステルが殆ど無色の粉末状で 165 79 得られた。

核 磁 気 共 鳴 スペクトル (CDC ℓ3) δ ppm:

1.17 (3 H, t, J = 6.5)

2. 4 1 (2 H, q, J = 6.5)

3.20 (3 H,S)

3.35 (2H, ABq)

4.02 (3H,S)

4.17 (2 H, S)

5.09 (1 H, d, J = 5)

5.6~6.3 (5 H, m)

6.68 (1H,S)

8.25 (1 H , d , J=9)

# 実施例 6.



実施例3の方法に従つて、ピバリン酸プロムメチルエステルの代りにαーエトキシカルボニルオキシエチルプロマイド(αーエトキシルルガーカルボニルオキシエチルクロリド 600 mg、臭化ナトリウム 800 mgをアセトニトリル 3 ml 中 1 0 時間加熱して調整)を用いて反応させ、全く同様に処理することによつて、7ー〔2ー〈2ーアミノチア・デ〕ー3ーメトキシメチルー3ーセフエムー4ーカルボン酸 1ーエトキシルボニルオキシエチルエステル60 mgを淡黄色粉末として得る。

核磁気共鳴スペクトル (CDCL3) δ<sub>ppm</sub>:

- 1.30 (3 H, t, J = 7)
- 1.61 (3 H, d, J = 5)
- 3.22 (3 H, S)
- 3.42 (2 H, A B q)
- 4.03 (3H,S)
- 4.15 (2H,S)
- 4.21 (2 H, q, J = 7)



$$35.10$$
 (1H,d,J=5)

$$8.20 (1 \text{ H}, \text{d}, \text{J} = 9)$$

#### 実施例7.

7-[2-(2-クロルアセトアミドチアゾールー4ーイル)ー2ーメトキシイミノアセトアミドコー3ーメトキシメチルー3ーセフエムー4ーカルボン酸(シン異性体)19をジメチルスルホキシド10ml中に加え,トリエチルアミン200mgを加え,ついでフタリジルブロマイド420mgを加える。室温で30分攪拌後,酢酸エチル100mlを加え,水,5%重曹水,飽和重硫酸カリウム水溶液,飽和食塩水で順次洗浄し,



硫酸マグネシウムで乾燥後,減圧で溶媒を留去する。残留物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー〔溶媒,クロロホルムー酢酸エチル(1:1)〕で精製すると,7一〔2一(2 ークロルアセトアミドチアゾールー4ーイル)ー2ーメトキシイミノアセトアミド〕ー3ーメトキシメチルー3ーセフエムー4ーカルボン酸フタリジルエステル710 % 黄色粉末として得られる。

上記化合物 300 *啊をチオ*尿素 6 0 *啊とジメチルアセトアミド3 配中*,室温で 4 時間反応させ以下実施例 3 の方法に従つて処理すると,7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-メトキシイミノアセトアミド]-3-メトキシメチル-3-セフエム-4-カルボン酸フタリジルエステル 120 *啊*を得る。

核磁気共鳴スペクトル (CDCℓ<sub>3</sub>) δ<sub>ppm</sub>

3.22 (3 H, S)

3.50 (2H,S)

3.95 (3 H, S)



4.17 (2H,S)

5.10 (1H, a)

5.82 (1 H, m)

6.58 (0.6 H, S)

6.67 (0.4H,S)

7. 3 ~ 8. 3 (5 H , m)

8.5 (2 H, br)

#### **実施例 8.**

実施例2の方法に順じて次の化合物を得る。

- (1) 7-[2-(2-アミノチアゾールー4ーイル) -2-ヒドロキシイミノアセトアミド] -3-メトキシメチル-3-セフエムー4ーカルボン酸 アセトキシメチルエステル
- (2) 1-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル) -2-ヒドロキシイミノアセトアミド] -3-メトキシメチルー3-セフエムー4ーカルボン酸 イソバレリルオギシメチルエステル
- (3) 7-[2-(2-アミノチアゾールー4-



イル) - 2 - ヒドロキシイミノアセトアミド]
- 3 - メトキシメチル- 3 - セフェム- 4 カルボン酸 フタリジルエステル

## 

実施例1の方法に順じて次の化合物を得る。

- (1) 7-〔2-(2-アミノチアゾールー4ーイル) -2-メトキシイミノアセトアミド〕-3-メトキシメチル-3-セフエムー4ーカルボン酸 アセトキシメチルエステル
- (2) 7-[2-(2-アミノチアゾールー4ーイル) -2-メトキシイミノアセトアミド] -3-メトキシメチルー3-セフエムー4ーカルボン酸 イソバレリルオキシメチルエステル
- (3) 7- [2-(2-アミノチアゾールー4-イル) -2-エトキシイミノアセトアミド] -3-メトキシメチル-3-ゼラエム-4-カルボン酸 ビッパロイルオキシメチルエステル
- (4) 7-[2-(2-アミノチアゾールー4-



イル) - 2 - メトキシイミノアセトアミド] - 3 - エトキシメチル- 3 - セフエム- 4 -カルボン酸 ピバロイルオキシメチルエステ ル

#### 実施例 1 Q

7 -[2 - (2 - ア ミ ノ チ ア ゾ ル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3 ーメトキシメチルー3 ーセフエムー4 ーカル ピバロイルオキシメチルエステル 500 ボン酸 **吻を酢酸エチル20㎡にとかした液に塩化水素** を飽和したエーテル 2 mlを加え,減圧で約 5 ml 迄 濃 縮し ,ついでジイソプロピルエーテル20 nd を加える。析出した結晶を沪取し、ジイソプ ロピルエーテルで洗浄,乾燥すると,7-[2 (2-アミノチアゾールー4-イル)-2 ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-メトキ シメチルー3 ーセフエムー4 ーカルボン酸 バロイルオキシメチルエステル 塩酸塩が得ら れる。収量 480 吗。



○全く同様にして、7-「2- (2-アミノチアゾールー4ーイル) -2-メトキシイミノアセトアミドコー3-メトキシメチルー3ーセフエムー4ーカルボン酸 ピバロイルオキシメチルエステル 500 吻から、その塩酸塩を 470 %得る。

特許出願人 三 共 株 式 会 社 代 理 人 弁理士 樫 出 庄 治

# 手続補正書(自発)

昭和55年11月[]日

特許庁長官 島田春樹 殿

1. 事件の表示

昭和55 年特許願第 136449号

2. 発明の名称

経口用セフアロスポリン化合物。

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 〒103 東京都中央区日本橋本町3丁目1番地の6

名称 (185) 三共株式会社

代表者 取締役社長 河村喜典

4. 代 理 人

居所 〒140 東京都品川区広町1丁目2番58号

三共株式会社内

電話 492-3131

氏名 弁理士 (6007) 樫出庄治

5. 補正により増加する発明の数 なし

6: 補正の対象 明細書の発明の詳細な説明の欄

7. 補正の内容 別紙の通り



1. 明細書第16頁下から3乃至2行目の 「N-ヒドロキシフタルイミドエステル」の後 に、

「 N - ヒドロキシベンズトリアゾール エステル」 を挿入する。

2. 同第29頁6行目の

「J-2.5 Hz」を

「J=5Hz」と訂正する。

3. 同第29頁7行目の

「J=2.5, 4.5Hz」を

「J=5,9Hz」と訂正する。

4. 同第31頁12 および13行目の

「J=2.5 Hz」を

「J=5Hz」と訂正する。

5. 同第33頁3および5行目の

「J=3 Hz 」を

「J-6Hz」と訂正する。

6. ・ 同第33頁6行目の

「J=2.5 Hz | を

「J=5Hz」と訂正する。

智慧

7. 同第33頁7行目の

「J=5,9Hz」と訂正する。

8. 同第33頁9行目の

「J=4.5 Hz」を

「J-9 Hz」と訂正する。

9. 同第34頁10行目の

「J=2.5 Hz」を

「J-5Hz」と訂正する。

10. 同第34頁11行目の

「J=2.5, 4.5 Hz」を

「J=5,9Hz」と訂正する。

11. 同第38頁1 および2行目の

「 J = 2.5 Hz 」 卷

「J=5 Hz」と訂正する。

12. 同第39頁14行目の

「 J = 2.5 Hz 」を

·「J=5Hz」と訂正する。

13. 同第42頁下から3行目の

「J=2.5 Hz」を

「J-5 Hz」と訂正する。

14. 同第 4 3 頁 2 行目の

「J=4.5 Hz」を

「J-9Hz」と訂正する。

15. 同第 4 5 頁 3 行目の

「J=2.5 Hz」を

「J=5日z」と訂正する。

16. 同第45頁7行目の

「J=4.5Hz」を

「J=9Hz」と訂正する。

以上



#### 続 書 (自発) 手 補 正

昭和56年7月16日

特許庁長官 島田 春 樹

1. 事件の表示

昭和55年特許願第136449 号

- 2. 発明の名称 経口用セフアロスポリン化合物
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 **〒**103 東京都中央区日本橋本町3丁目1番地の6

名称

(185) 三共株式会社

代表者 取締役社長 河 村 喜 典

4. 代 理人

居所 〒140 東京都品川区広町1丁目2番58号

三共株式会社内

電話 492-3131

氏 名

弁理士 (6007)

樫 出 庄

5. 補正により減少する発明の数 . 1

明細書の特許請求の範囲の欄及び発明の 6。補正の対象

詳細な説明の欄

7. 補正の内容 別紙の通り



# 訂 正 明 細 書

- 1. 発明の名称 経口用セフアロスポリン化合物
- 2 特許請求の範囲
  - (1) 一般式

(式中、R1はメチル基またはエチル基を表わす。)で示されるセフアロスポリン化合物(シン異性体) およびその薬学的に許容し得る<u>酸付加塩。</u>

# (2) 式

で示される化合物を、一般式



(式中、R<sub>2</sub>はアミノ基または保護されたアミノ基を、R<sub>1</sub>はメチル基またはエチル基を表わす。) で示されるカルボン酸またはその反応性誘導体 と反応させ、一般式

(式中、R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> は前述したものと同意 義を有する。)を有する化合物を製造し、R<sub>2</sub> が保護されたアミノ基である場合にはその保護 基を除去することを特徴とする一般式

(式中、R<sub>1</sub>は前述したものと同意義を有する。)

を発生

で示されるセフアロスポリン化合物(シン異性体)およびその薬学的に許容し得る酸付加塩の 製造法。

#### (3) 一般式

(式中、R<sub>1</sub>はメチル基またはエチル基、R<sub>2</sub>はアミノ基または保護されたアミノ基を表わす。)で示されるカルボン酸化合物またはその反応性誘導体を一般式

$$XCH_2OCOC(CH_3)_3$$

(式中、Xはハロゲン原子を表わす。)で示される化合物と反応させ、一般式

(式中、 $R_1$  および  $R_2$  は前述したものと同意 義を有する。)を有する化合物を製造し、 $R_2$ 



が保護されたアミノ基である場合にはその保護 基を除去することを特徴とする一般式

(式中、R<sub>1</sub>は前述したものと同意義を有する。) で示されるセフアロスポリン化合物(シン異性 体) およびその薬学的に許容し得る<u>酸付加塩</u>の 製造法。

## (4) 一般式

(式中、R<sub>1</sub>はメチル基またはエチル基を表わす。)で示されるセフアロスポリン化合物(シン異性体) およびその薬学的許容し得る<u>酸付加塩</u>を有効成分として含有する経口投与用細菌感染症治療剤。





## 3. 発明の詳細な説明

本発明は経口投与用セフアロスポリン化合物 に関する。更に詳しくは、本発明は一般式(I)

$$\begin{array}{c|c}
 & N & C & CONH & S \\
 & H_2N & S & N & CH_2OCH_3 \\
\hline
 & OR_1 & COOCH_2OCOC(CH_3)_5
\end{array}$$
(1)

(式中、R1はメチル基またはエチル基を表わす。)で示されるセフアロスポリン化合物(シン異性体)およびその薬学的に許容し得る酸付加塩、その製造法並びにその化合物を有効成分として含有する経口投与用細菌感染治療剤に関する。



本発明に係る前記一般式(I)を有する化合物は新規化合物であり、消化管からの吸収がよく、且つ生体内で速かに 4 位のエステル部分が分解してカルボン酸型になるため、カルボン酸型化合物の高い血中濃度を得ることができ、したがつて経口投与によつてグラム陽性菌およびグラム陰性菌等の感染症の治療に対して極めて顕著



な効果を有する広範囲抗生物質である。カルボン酸型化合物も新規な化合物であり、その抗菌活性は後述するように極めてすぐれた活性を有する。

ペニシリン系、セフアロスポリン系抗生物質 には、多くの優れた効果を有する化合物がみら れるが、消化管からの吸収のよいものは極めて 少なく、そのために実用化されないまゝ開発を 断念された化合物も少くない。殊にセファロス ポリン系抗生物質においてはセフアレキシンあ るいはその類似体のように限られた構造を有す る化合物のみが実用に供されているにすぎない。 例えば注射用セフアロスポリン剤として汎用さ れているセファロチン、セファゾリン、セフメ タゾール等を経口投与した場合の尿中回収率は いずれも投与量の5%前後で、消化管からの吸 収は極めて悪いことが知られている。その理由 はセフアロスポリンの4位のカルボキシル基の 解離度が大きく(pKa値が小さく)酸性が強い ためである。



そこでペニシリンの3位およびセフアロスポリンの4位のカルボキシル基をエステル化することによつて、消化管からの吸収を改善しようとする試みがなされており、ペニシリン系化合物については一、二実用化されているものがあるが、セフアロスポリン系化合物についてはみられない。



述されている。

本発明者は、長年に亘つてセフアロスポリン化合物の化学的修飾による消化管からの吸収の改善、経口投与による血中濃度の増大について研究を重ねたが、それらの性質は、化合物の構造全体に関連し、構造の一部分に変化があれば同じような化学的修飾例えばエステル化を行なつても、その消化管からの吸収は全く予測し得ないことを知つた。本発明は、そのような研究の結果なされたものである。

即ち、本発明の化合物と一見構造が類似している下記公知化合物のピバロイルオキシメチルエステルを合成し、経口投与による尿中回収率を試験したところ、必ずしも良い結果は得られず、この系統の化合物に関しては3位の置換基が極めて重要を役割を果していることを見出した。



化合物 1 R<sub>1</sub> = CH<sub>3</sub> A = CH<sub>2</sub>OCOCCH<sub>3</sub> N-N
2 R<sub>1</sub> = CH<sub>3</sub> A = CH<sub>2</sub>S 
$$\stackrel{N-N}{\downarrow}$$
 CH<sub>3</sub>

本発明に係る前記式(I)を有する化合物は、以下に述べる方法、すなわち

- (a) エステル化された 7 アミノ 3 メトキ シメチルセフアロスポリン(II) のアシル化法 あるいは
- (b) 化合物(l) に対応するカルボン酸またはその アミノ基が保護された化合物(V) のエステル化 法および脱保護化法
- によつて製造することができる。

上記の方法は具体的には次のように実施される。

(a) は式

$$H_2 N \longrightarrow S$$
 $CH_2 O CH_3$ 
 $COOCH_2 O COC(CH_3)_3$ 
(II)



で示される化合物を、一般式

(式中、R2はアミノ基または保護されたアミノ基を、R1はメチル基またはエチル基を表わす)で示されるカルボン酸またはその反応性誘導体と反応させ、一般式

$$\begin{array}{c|c}
N & C & CONH & S \\
R_2 & N & CH_2 O CH_3 \\
OR_1 & COOCH_2 O CO C (CH_3)_3
\end{array}$$
(IV)

(式中、R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> は前述したものと同意義を有する。)を有する化合物を製造し、R<sub>2</sub>が保護されたアミノ基である場合にはその保護基を除去することによつて目的化合物(I)が製造される。

上記式中、R<sub>2</sub>が保護されたアミノ基である場合のアミノ基の保護基としては、容易に除去されてアミノ基に復元されるものが好ましく、そ



れ自体公知の保護基例えば酸処理で除去しうるトリチル基、ホルミル基、セーブトキシカルボニルー1ーメチルビニル基、アルカリ処理で除去できる2ーメチルスルホニルエチルオキシカルボニル基、チオ尿素処理で除去しうるクロルアセチル基などが使用される。

本方法はアシル化工程と必要な場合には脱保 護工程との2工程よりなる。



本工程は通常溶媒中で行なうのが好ましく、使用される溶媒は本反応に悪影響を与えなメチルのであれば限定なく、例えばアセトン、メチャン、チャーン、テトラにドロフラン、カキチン、酢酸エチル、クロホルム、ジクロルメチン、アセトニトリル、ジメチルカアをどの不活性有機溶媒などが使用される。使用されるの混合溶媒などが使用される。使用されるの混合溶媒などが使用される。使用されるの混合溶媒などが使用される。使用されるの混合溶媒などが使用される。使用されるの混合溶媒などが使用される。使用されるの混合溶媒などが使用される。使用されるの混合溶媒などが使用される。使用されるの混合溶媒などが使用される。





れる反応性誘導体の種類によつては必要に応じ 塩基を存在させることがある。塩基の例として はアルカリ金属化合物例えば重炭酸ナトリウム、 重 炭 酸 カ リ ウ ム 、 炭 酸 ナ ト リ ウ ム 、 炭 酸 カ リ ゥ ムなど、脂肪族、芳香族、含窒素複素環塩基例 えばトリエチルアミン、ジメチルアニリン、ジ エチルアニリン、N-メチルピペリジン、N メチルピロリジン、ビリジン、コリジン、ルチ ジンがあげられる。反応温度に特に限定はない が通常反応は室温又は冷却下で行なわれる。反 応に要する時間は主としてアシル化方法の種類、 反応温度等によつても異なるが通常数十分乃至 数十時間である。反応終了後、式伽を有する化 合物は常法によつて反応混合物から採取される。 例えば反応溶媒が水混和性の場合には一旦減圧 で留去した後水不混和性溶媒に代え、溶媒が水 不混和性の場合はそのまゝ酸および塩基で洗い、 乾燥した後溶媒を留去することによつて得られ る。必要に応じ常法例えば各種クロマトグラフ イー等によつて精製することもできる。



脱保護工程は先に述べたように、各保護基の 特性に基いて常法によつてそれらの保護基を除 去し、粗生成物を精製して式(I)を有する目的化 合物を得ることができる。

また、(b)は一般式

$$\begin{array}{c|c}
N & C & CONH & S \\
R_2 & N & CH_2 O CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 O CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 O CH_3
\end{array}$$

(式中、R<sub>1</sub> および R<sub>2</sub> は前述したものと同意 義を有する)を有するカルボン酸化合物または その反応性誘導体を式

$$\times CH_2 \circ C \circ C (CH_3)_3$$
 (V)

(式中、xは塩素、臭素または沃素のようなハロゲン原子を表わす。)を有する化合物と反応させ前記式(M)を有する化合物を得て、更にR2が保護されたアミノ基である場合には(a)法と同様にして脱保護することによつて目的化合物(l)が製造される。

本反応に おいて、式(V)を有する化合物を縮合



に有利な反応性誘導体として使用してもよい。 式(V)を有する化合物のカルボン酸部分の反応性 誘導体としては、例えばナトリウム、カリウム のような金属との塩、トリエチルアミン、ジシ クロヘキシルアミンのような有機アミンとの塩 等があげられる。反応は適当な溶媒中で行なり のが好ましく、そのような溶媒としては本反応 に悪影響をおよぼさないもの例えばジメチルホ ルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチル スルホキシド、ヘキサメチルトリアミドホスフ エート、アセトニトリル等或いは他の不活性有 機溶媒との混合溶媒があげられる。反応は通常 室温または冷却下に行なうのが好ましい。反応 に要する時間は通常数分乃至数時間である。反 応終了後、反応混合物を水不混和性溶媒で稀釈 し、重硫酸カリウム水溶液および塩基水溶液で 洗い、乾燥後溶媒を留去することによつて本反 応の目的化合物を得ることができる。このもの は更に常法例えば各種クロマトグラフィーによ り精製することができる。アミノ基が保護され



ている場合には、前記式®を有する化合物の脱保護と同様にしてアミノ基に変換される。

以上の製造法によつて得られる前記式(1)を有 する本発明の化合物は、前記の如く消化管から の吸収がよく、カルボン酸型化合物の高い血中 濃度を与えるので経口投与が可能であり、製薬 的常法によつて例えばデンプン、乳糖、白糖、 炭酸カルシウム、リン酸カルシウム、ポリエチ レングリコール等の賦形剤、例えばアラビアゴ カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシ プロビルセルロース等の結合剤、例えばステア リン酸マグネシウム、タルク、ラウリル硫酸ナ トリウム等の滑沢剤、例えばカルボキシメチル セルロースカルシウム等の崩壊剤などと混合し てカプセル剤、散剤、顆粒剤、錠剤等経口投与 剤を製造することができる。その投与量は、年 令、体重、症状等によつても異なるが、成人に 対 し 1 日 約 0. 2 乃 至 5 8 、好 ま し く は 0. 5 乃 至 8であり、3乃至4回に分けて与えることが できる。



また、前記式(I)を有する化合物を使用するに当つて、遊離の型のみでなく薬学的に許容しうる酸付加塩例えば、塩酸、硫酸、硝酸のような無機酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、マロン酸などのような有機酸の酸付加塩としても使用される。

本発明の化合物を経口投与すると、前述の如く、腸管より容易に吸収され、生体内で加水分解されて対応するカルボン酸(1')

(式中、R<sub>1</sub>は前記と同意義を示す。)またはその塩になる。化合物(I')のグラム陽性菌および陰性菌に対する抗菌活性(最小発育阻止濃度,μg/ml)は下記の如く極めて顕著なものである。

化合物 (1')
$$A B$$

$$R_1 = CH_3 R_1 = C_2H_5$$



スタヒロコツカス・アウレ	0. 4	0. 2
ウス 209 P		
エシエリヒア・コリ NI HJ	0. 4	. 0. 8
シゲラ・フレキシネリ	0. 8	0. 4
クレプシエラ・ニューモニエ	0. 1	0. 2
プロテウス・ブルガリス	0.01	0.01
サルモネラ・エンテリ チジス	0. 2	0.4

また本発明の化合物および前述の類縁化合物 (化合物 1 および 2 )をマウスに経口投与した 時の尿中回収率(対応するカルボン酸の量)は 夫々次の通りである。

尿中回収率(%)(0~24時間)

実施例1の化合物	7 5. 9
実施例2の化合物	7 8
化合物1	8
化合物 2	1 4



このように本発明は上記化合物 1 および 2 のようなセフアロスポリン化合物の 3 位の置換基をメトキシメチル基にすることによつて消化管吸収が極めて良くなる点に特長がある。

次に参考例をよび実施例をあげて前記式(I)を有する本発明の化合物の製造方法を具体的に説明するが、本発明はこれによつて限定されるものではない。なお、本発明の化合物のオキシム部分の異性体はすべてシン型である。参考例 1.

<u>1-フェノキシアセトアミドー3-メトキシ</u> メチルー3-セフエムー4-カルボン酸ピバロ イルオキシメチルエステルの製造法

7-フェノキシアセトアミドー3-メトキシメチルー3-セフェムー4ーカルボン酸ナトリウム塩1gをジメチルスルホキシド50mlに溶解し、ピバロイルオキシメチルプロミド 975 mgを加えて室温で15分間攪拌後、酢酸エチル200 mlを加え、飽和重炭酸ナトリウム水溶液50ml、飽和重硫酸カリウム水溶液50ml、飽和重硫酸カリウム水溶液50mlで原次流

浄し、無水硫酸マグネシウムで脱水乾燥後、乾燥剤を沪去して減圧濃縮する。

こうして得た残渣をシリカゲル 100 g、溶媒系 n - へキサン - 酢酸エチル(1:1)を用いてクロマトグラフィー処理し、7 - フェノキシアセトアミド-3 - メトキシメチル-3 - セフエム-4 - カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステル 750 mg を得た。

核磁気共鳴スペクトル (CDCl<sub>3</sub>) δ<sub>ppm</sub>

- 1. 2 5 ( 9 H , s )
- 3.35(3H, B, 3位 OCH<sub>3</sub>)
- 3.54(2H, B, 2位 CH<sub>2</sub>)
- 4.29(2H, B, 3位 CH<sub>2</sub>)
- 4.58 (2 H , s ,  $CH_2-O-P_{he}$ )
- 5.01(1H,d,J-5Hz,6位)
- 5.6~6.1 (3H,m,7位およびCH<sub>2</sub>)
- 6.7 ~ 7.6 (6 H , m , Phenyl & LU NH)

参考例 2



トアミド]-3-メトキシメチル-3-セフェ ム-4-カルボン酸ジフエニルメチルエステル の製造法

反応液(A) ジメチルホルムアミド 0.057 ml に、氷冷 攪拌しながらオキシ塩化リン 0.061 ml を加え、 40℃に加温して1時間攪拌後、乾燥した塩 化メチレンを用い2回共沸する。これに酢酸 エチル1 ml を加え、室温ではげしく攪拌しな がら2-(2-クロルアセトアミドチアソー ル-4-イル)-2-メトキシイミノ酢酸 200 mg を加え3 0 分間反応する。

混合液(B) 一方、7-アミノ-3-メトキシメチル-3-セフエム-4-カルボン酸ジフエニルメチルエステル 200 吻をジエチルアニリン145 吻と共に、乾燥した塩化メチレン 5 ml に溶解し、-5℃に冷却して攪拌する。

この混合液的に前述の反応液(A)を滴下して15 分間攪拌後、反応液を減圧濃縮する。

残渣を酢酸エチル 2 0 ml および水 5 ml を用いて分液する。酢酸エチル層を分離し、さらに順



次、飽和重炭酸ナトリウム水 5 ml、 5 % 塩酸水 5 ml、飽和食塩水 5 mlで洗浄し、無水硫酸マグネシウムを加えて脱水乾燥する。乾燥をシリカゲル(Kieselgel-60)30g、溶媒系カーへキサンー酢酸エチル(3:2)を用いてマートクラフイー処理し、7-[2-(2-クロルアセチルアミノチアゾールー4ーイル)-2-メトキシイミノアセトアミド]-3-メシメチル-3-セフエムー4ーカルボン酸ジエニルメチルエステル 213 mg を得た。

核磁気共鳴スペクトル (CDC $\ell_3$ )  $\delta_{\mathrm{ppm}}$ 

- 3.19(3H, s, 3位 OCH<sub>3</sub>)
- 3.51(2H,s,2位 CH<sub>2</sub>)
- 4.09 (3 H, s, OCH<sub>3</sub>)
- 4.20(2H,s,3位 CH<sub>2</sub>)
- 4. 2 2 ( 2 H , s , C&CH<sub>2</sub>·CO )
- 5.02(1H,d,J=5Hz,6位)
- 5.86(1H,d.d,J=5,9Hz,7位)
- 6.7 ~ 7.6 (12 H, m)



(b) <u>7-[2-(2-クロルアセトアミノチア</u> <u>ゾールー4ーイル)-2-メトキシイミノアセトアミド]-3-メトキシメチル-3-セフェ</u> <u>ム-4-カルボン酸の製造法</u>

核磁気共鳴スペクトル(重アセトンと重DMSO湿液)

 $\delta_{ppm}$ 

3.30(3H, s, OCH<sub>3</sub> 3位)



3.60(2H,s,2位 CH<sub>2</sub>)

3.97 (3 H, s, OCH<sub>3</sub>)

4.25(2H, s, 3位 - CH<sub>2</sub>-)

4.37 (2 H , s ,  $C\ell CH_2CO$ )

5.20(1H, a, 6位 H)

5.90(1H,d,d,7位H)

7.40(1日,8,チアゾール 5位)

9.50(1H,d,7位 CONH)

### 参考例 3.

<u>7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-メトキシイミノアセトアミド]-3</u> -メトキシメチル-3-セフエム-4-カルボン酸トリフルオロ酢酸塩の製造法

7-[2-(2-クロルアセトアミドチアゾールー4-イル)-2-メトキシイミノアセトアミド]-3-メトキシメチルー3-セフエムー4-カルボン酸ジフエニルメチルエステル200 rgをN,N-ジメチルアセトアミド5 mlに容解し、チオ尿素 4 5 rgを加えて溶解し、室温で2時間反応する。反応液に飽和重炭酸ナトリ



これをアニソール 2 ml に溶解し、氷冷攪拌下にトリフルオロ酢酸 1 ml を加え、室温にして30分処理する。反応液を減圧濃縮し、イソプロピルエーテルを加えて生じた沈澱を沪取し、乾燥して、1-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-メトキシイミノアセトアミド]-3-メトキシメチルー3-セフエムー4-カルボン酸トリフルオロ酢酸塩27mgを得た。

核磁気共鳴スペクトル (重アセトン中,重水添加)



 $\delta_{ppm}$ 

3.29(3H, s, 3位 -OCH<sub>3</sub>)

3.57(2H, s, 2位 CH<sub>2</sub>)

3.96(3H,8, OCH<sub>5</sub>)

4.27(2H, s, 3位 CH<sub>2</sub>)

5.15(1H,d,J=5Hz,6位)

5.97(1H,d,J=5Hz,7位)

6.59(1H,s)

**寒施例1.** 

7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-メトキシイミノアセトアミド]-3
 -メトキシメチルー3-セフエムー4ーカルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルの製造法

五塩化リン 488 吻を乾燥した塩化メチレン 5 ml に溶解し、オキシ塩化リン 120 吻を加え、室温で攪拌しながらビリジン 247 吻を加える。こ

れを-10℃ まで冷却し、参考例2-(b)におい て得られた7-フエノキシアセトアミド-3-メトキシメチルー3 - セフエム - 4 - カルボン 酸ピパロイルオキシメチルエステル 769 吸を加 え、徐々に室温にもどす。2時間攪拌後再び0℃ に冷却し、n-プロピルアルコール 1.5 mlを加 えて30分間攪拌する。さらに少量の水を加え **15分攪拌し、酢酸エチル50mlを加え飽和重** 炭酸ナトリウム水で洗浄する。酢酸エチル層を 無水硫酸マクネシウム上で乾燥し、乾燥剤を沪 去して減圧濃縮する。これにイソプロピルエー テルを加えてこすり、生じた沈澱を沪取乾燥し て、1-アミノー3-メトキシメチルー3-セ フェムー4ーカルポン酸ピバロイルオキシメチ ルエステル 443 昭を得た。

こうして得た 7 - アミノー 3 - メトキシメチ ルー 3 - セフエムー 4 - カルボン酸 ピバロイル オキシメチルエステル 121 mg、ジエチルアニリ ン 141 mg、およびジメチルホルムアミド 7 1 mg、 オキシ塩化リン 135 mg、 2 - ( 2 - クロルアセ



トアミドチアゾールー4ーイル)ー2ーメトキシイミノ酢酸 265 Wを用い参考例 2ー(a) の場合と同様にアミド化し、反応液を分液抽出して目的物を含む残渣を得、これをシリカゲル10g 溶媒系酢酸エチルーローへキサン(2:1)を用いてクロマトグラフイー処理して、7β-[2ー(2ークロルアセトアミドチアゾールー4ーイル)ー2ーメトキシイミノアセトアミド]ー3ーメトキシメチルー3ーセフエムー4ーカルボン酸ピベロイルオキシメチルエステル55 Wを得た。

これをN,N-ジメチルアセトアミドー配に 溶解し、チオ尿素 13.5 mg を加え室温で 2 時間攪 拌後酢酸エチル2 0 ml を加えて、飽和重炭酸ナ トリウムでよく洗浄し、無水硫酸マグネシウム 上で脱水乾燥し、乾燥剤を沪去して減圧濃縮し た。これをシリカゲル5 g、溶媒系酢酸エチル ー n ー へキサン(3:1)を用いてクロマトグ ラフイー処理し、7-[2-(2-アミノチア ゾールー4-イル)-2-メトキシイミノアセ



トアミド] - 3 - メトキシメチル - 3 - セフェム - 4 - カルボン酸ピパロイルオキシメチルエステル 3 6 写を得た。

核磁気共鳴スペクトル (重アセトン中) δ<sub>ppm</sub>

1.19(9H,s)

3.23(3H,s,3位 OCH<sub>3</sub>)

3.52 (2 H,s,2位  $\mathrm{CH}_2$  )

 $3.90\ (3\ \text{H}\ ,\text{s}\ ,\text{OCH}_{3}\ )$ 

4.18(2H,s,3位 CH<sub>2</sub>)

5.12(1H,d,J=5Hz,6位)

5.8~6.1 (3 H , m , 7位および CH<sub>2</sub> )

6.78 (1 H , s)

6.6  $\sim$  7.1 ( 2 H , bs ,  $\mathrm{NH}_2$  )

8.01(1H,d,J=9Hz,NH)

# 実施例 2.

実施例1の方法に順じて次の化合物を得た。

<u>7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-エトキシイミノアセトアミド]-3</u>
<u>-メトキシメチル-3-セフエム-4-カルボ</u>ン酸 ピバロイルオキシメチルエステル



核磁気共鳴スペクトル (重クロロホルム) δ ppm

1.22(9H,8)

1.31 (3  $\mathrm{H}$  ,  $\mathrm{t}$  ,  $\mathrm{OCH}_2\mathrm{CH}_3$  )

 $3.\ 3\ 0$  (  $3\ \mbox{H}$  ,s ,ocH  $_3$ 

3.53(2H, s, 2位 CH<sub>2</sub>)

4.30 (  $2\,\mathrm{H}$  ,s ,  $3\,\mathrm{\dot{M}}$   $\mathrm{CH}_2$  )

4.28(2  $\rm H$  ,  $\rm q$  ,  $\rm OCH_2\,CH_3$  )

5.01(1H,d,J=5Hz,6位)

5.7 ~ 6.2 (5 H , m , 7 位 H , NH<sub>2</sub> , COOCH<sub>2</sub>-O- )

6.76(1日, 8,チアゾール 5位)

7.70 (1 H, d, J = 9 Hz, CONH)

実施例3.



参考例2-(b)において得られた7-[2-(2 - クロルアセトアミドチアソール - 4 - イル) 2 - メトキシイミノアセトアミド ] - 3 - メ トキシメチルー3ーセフエムー4ーカルポン酸 (シン異性体) 1 8 、ビバリン酸プロムメチル エステル 380 吻および弗化カリ 240 吻をジメチ ルスルホキシド10㎡に加え、室温で1時間攪 拌する。反応液に酢酸エチル 100 ml を加え、水、 5 多 重 曹 水 、 1 0 多 重 硫 酸 カ リ ウ ム 水 溶 液 、 飽 和食塩水で順次洗浄し、硫酸マクネシウムで乾 燥後、減圧で溶媒を留去する。残留物をシリカ ゲルを用いたカラムクロマトグラフィー [溶媒, クロロホルム - 酢酸エチル(1:1)で精製す ると、7-[2-(2-クロルアセトアミドチ アゾールー4ーイル) -2 -メトキシイミノア セトアミド] - 3 - メトキシメチル - 3 - セフ エムー4ーカルポン酸ピパロイルオキシメチル エステル300 吸が淡黄色粉末状で得られた。

上記化合物およびチオ尿素 6 0 mgをジメチルアセトアミド 3 ml に溶かし、室温で 4 時間攪拌



する。反応液を飽和重曹水10㎖中に注ぎ、酢 酸エチルで抽出する。抽出液を10多重硫酸カ リウム水溶液、飽和食塩水で順次洗つた後、硫 酸マグネシウムで乾燥後、減圧で濃縮する。残 留物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラ フィー[溶媒,酢酸エチル-n-ヘキサン(3 )]で精製すると、7-[2-(2-アミ ノチアゾールー4-イル)-2-メトキシイミ ノアセトアミド] - 3 - メトキシメチル - 3 -セフエム - 4 - カルボン酸ピバロイルオキシメ チルエステル 200 写を得た。本品は実施例1の 方法で得た化合物と同一であることを核磁気共 鳴スペクトル、赤外線吸収スペクトルで確認し た。

# 実施例 4.

7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-メトキシイミノアセトアミド]-3 ーメトキシメチルー3-セフエムー4-カルボン酸 ピバロイルオキシメチルエステル 500 砂を酢酸エチル2 0 ml にとかした液に塩化水素を



飽和したエーテル2mlを加え、減圧で約5ml迄 濃縮し、ついでジイソプロピルエーテル20ml を加える。析出した結晶を沪取し、ジイソプロ ピルエーテルで洗浄、乾燥すると、7-[2-(2-アミノチアゾールー4ーイル)-2-メ トキシイミノアセトアミド]-3-メトキンメ チルー3-セフエムー4-カルボン酸 ビれた。 収量 470 mg。

特許出願人 三 共 株 式 会 社 代 理 人 弁理士 樫 出 庄 治

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.